



ViEW2006

ビジョン技術の実利用ワークショップ

<http://www.tc-iaip.org/view2006/>

開催日:2006年12月7日(木)、8日(金)

会場:パシフィコ横浜 アネックス・ホール(横浜市西区みなとみらい1-1-1)

ViEW2006(Vision Engineering Workshop)は、横浜ベイエリアで開催される恒例行事として春の SSII、秋の ViEW(ビュー)として親しまれております。

本ワークショップは、これまで17年間に亘り日本における「ものづくり」を支える基盤技術として外観検査など生産技術に関わる画像処理応用技術の発信源として貢献してまいりました。最近では画像処理、マシンビジョンの応用分野が着実に広がっております。これに呼応し、人や車の認識理解など交通からセキュリティなど社会システムまで視野を広げたビジョン技術の実利用を追及し、実用化をめざす多くの企業や大学の皆様の発表と意見交換、情報収集の場として評価いただいております。毎回特別講演、パネル討論などで最新の話題が提供されてまいりました。おかげさまで昨年は、400人を超える方々にご参加頂き活発な議論で盛り上がりを見せました。新たに特色ある成果を口頭発表とインタラクティブで発表するハイブリッドオーラルの採用と、これらの成果と基調講演をテーマ別に組み合わせたハイブリッドセッション構成により親しみやすく参加者全員が最新の情報を共有できるシングルトラック方式を実現しました。今年の ViEW2006 ではこの新しい枠組みをさらに充実し、多くの方々に満足いただける場を提供したいと思っております。

企業の参加者が過半数を超える真に実用化を志向した本ワークショップを盛り立てる企業・公の研究所および大学の研究者、技術開発者から魅力ある投稿を期待しております。

スコープ:ワークショップの募集する対象分野を示します。ただし、実用的であれば応募対象はこれらに限られるものではありません。

- 外観検査、欠陥検査・分類
- ロボットビジョン、マシンビジョン
- 画像計測(位置、姿勢、サイズ)、計数システム、品質管理用画像応用技術
- 非破壊検査のための画像処理
- 感性画像計測、クラスタリング、カラー画像情報処理
- 画像パターン認識、認識アルゴリズム、特徴抽出処理、モデル依存型認識
- 光学的画像処理・計測
- 3次元画像処理、距離画像認識
- セキュリティ応用、監視、個人識別
- 実環境のビジョンセンシングと認識
- 映像情報処理、メディア処理
- バイオ、人間応用の画像処理
- 食品・医薬品産業における画像処理
- 高度情報交通システム、運転状態計測、運転支援ビジョン
- IC タグと組み合わせた画像処理システム

主催:精密工学会

共同企画:画像応用技術専門委員会、知能メカトロニクス専門委員会(精密工学会)、マシンビジョンの実利用技術調査専門委員会、非整備環境におけるパターン認識応用分野拡大協同研究委員会(電気学会)、パターン計測部会(計測自動制御学会)、画像処理特別研究委員会(日本非破壊検査協会)

協賛:電気学会、計測自動制御学会、情報処理学会、日本ロボット学会、電子情報通信学会、回路実装学会、センシング技術応用研究会、日本電気制御機器工業会、日本非破壊検査協会、精機通信社、映像情報インダストリアル

同時開催:国際画像機器展(12月6、7、8日) 連絡先:(株)精機通信社 TEL:03-3367-0571

実行委員会:山本和彦(岐阜大;委員長)、青木義満(芝浦工大;幹事)、大塚裕史(日立;幹事補佐)、菅野純一(ファースト) 糊澤信(旭硝子)、斎藤英雄(慶應大)、佐藤雄隆(産総研)、諏訪正樹(オムロン)、内藤貴志(豊田中研)、野口稔(日立ハイテクノロジーズ)、橋本学(三菱電機)、藤原伸行(明電舎)、堀修(東芝)、山田敬嗣(NEC)、横山良雄(デンソー)

プログラム委員会:梅田和昇(中央大;委員長)、加藤邦人(岐阜大;幹事)、石井明(香川大)、大恵俊一郎(徳島大)、大城英裕(大分大)、小澤慎治(慶應大)、坂上勝彦(産総研)、白井良明(立命館大)、高橋悟(香川大)、中村奈津子(日本電子)、橋本周司(早稲田大)、藤原孝幸(中京大)、山下淳(静岡大)、山本新(名城大)

アドバイザーボード:斎藤之男(東京電機大)、石井明(立命館大)、岡昌世(元池上通信機)、秦清治(香川大)、原靖彦(日本大)、輿水大和(中京大)、中川泰夫(日立)、角田興俊(東京電機大)

組織委員会:金子俊一(北大;委員長)、浅野敏郎(広島工大)、伊藤裕(東京電機大)、牛田善喜(隆祥産業)、梶谷誠(信州大)、加藤章(中部大)、北川克一(東レエンジニアリング)、肥塚哲男(富士通研)、駒野目裕久(池上通信機)、渋谷久恵(日立)、白川弘明(福岡工大)、菅泰雄(慶應大)、田口亮(武蔵工大)、塚田弘志(東芝)、寺田賢治(徳島大)、中野宏毅(日本IBM)、中村明生(東京電機大)、西田広文(リコー)、西川喜八郎(西川技術士事務所)、前田祐司(古川製作所)、明愛国(電通大)、村上俊之(慶應大)

講演申込み:

期限:講演申込 2006年8月25日(金)、原稿提出 2006年10月20日(金)

申込先:上記の ViEW2006 ホームページから申し込み可能です。郵送或いは FAX の場合は、下記の宛先:

〒182-0026 調布市小島町 1-11-6 エンケ 102 (株)キャンパスクリエイト内 画像応用技術専門委員会事務局
ViEW2006 係 TEL&FAX:042-441-1809 e-mail:gazoh@campuscreate.com

申込方法:講演1件につき代表者の方がお送りください。講演題目、希望発表形式(オーラル、ハイブリッドオーラル、インタラクティブの別)、講演者氏名(フリガナ)、協賛組織会員/非会員/学生の別、講演者所属、連名者氏名(フリガナ)・所属、連絡者氏名(フリガナ)、連絡者の所属、連絡先住所(郵便が届く内容)、電話、FAX、確認用 E-mail の情報、概要(連絡先を含め A4 一枚に収まる長さ)を電子メールでお送りください。講演申込書式(電子メール用)は上記ウェブサイト上からダウンロードできますのでご利用ください。後、数日中に確認メールを返信します。この確認メールの届かない場合には、事務局にお問合せくださるようお願い致します。適当な様式をお作りの上、郵送或いは FAX での申込みも可能です。

